

知的財産戦略本部会合(第9回)

「知的財産推進計画」の 更なる加速

2004年12月16日

キヤノン株式会社
代表取締役社長

御手洗 富士夫

1. スピーディーな産学連携の実現

現場の実態に応じた【柔軟な運用ルール】の策定が必要

(1) 不実施補償 / 公共性・公平性

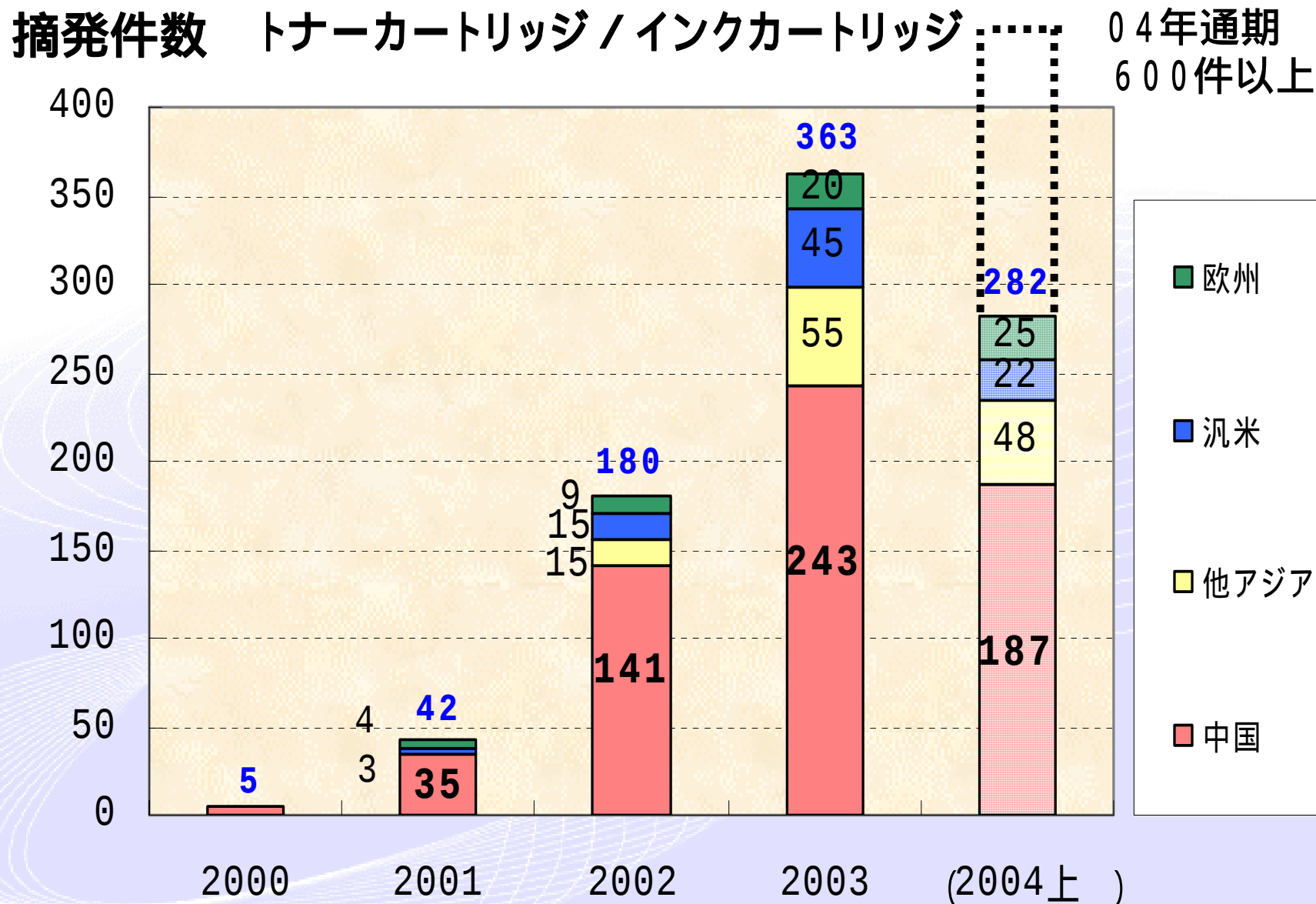
* 大学側は、【雛形契約】により一律に運用
するのではなく現場の実態に応じて柔軟に取扱う

(2) 海外への特許出願の取扱い

* 海外にて特許をとることが
日本国内に知的財産権を蓄積することになる

* 費用については、大学と企業で協議する

2. 模倣品対策 (キヤノンの摘発状況)



2. 模倣品対策（更なる取組強化へ）

官民が連携して国益を守る！

（1）海外における侵害状況調査制度の整備

日本政府は

企業からの申立により、

当該国での実態調査を実施

解決に向けた、当該国との2国間協議等を実施

（2）水際取締りでの対策強化

技術的判断が出来る専門家を活用して、

特許権活用の拡大を図る